

2026 年 8 月 20 日

株式会社 A D E K A

A D E K A、先端フォトレジスト向け光酸発生剤の生産能力を増強

～旺盛な EUV 需要に即応、PAG モノマーの量産対応を加速～

株式会社 A D E K A（代表取締役社長兼社長執行役員:城詰秀尊、本社:東京都荒川区、以下 A D E K A）は、EUV（極端紫外線）をはじめとする半導体の先端リソグラフィ工程で使用される半導体レジスト用光酸発生剤の生産設備を増強することを決定しましたのでお知らせいたします。千葉工場（千葉県袖ヶ浦市）の既存建屋内に製造ラインを増設し、2028 年 9 月に営業運転を開始する予定です。

半導体は現代の戦略物資として、世界的に投資が活発化しており、市場は 2026 年に 1.5 兆ドル規模へ前倒しで拡大するなど、急速な成長を続けています。これに伴い、半導体の微細化に不可欠なフォトレジスト市場も拡大しているほか、露光技術の進化や PFAS フリーなどの環境対応により、材料に求められる性能や品質レベルも一段と高度化しています。

A D E K A は、半導体材料事業において、ArF や EUV などの超微細加工が求められる先端リソグラフィ領域を重点分野と位置づけ、化学増幅型レジスト（CAR）用光酸発生剤や金属酸化物レジスト（MOR）用金属化合物の開発、供給体制の強化を進めています。今回の追加投資は、旺盛な需要が続く EUV リソグラフィ向け光酸発生剤の供給能力を高めるとともに、1 ppb レベルの厳格なメタル管理を維持しながら、生産体制の最適化を図るものです。同時に、2026 年 7 月に本格始動した半導体イノベーションセンター（埼玉県久喜市）では、EUV や高 NA EUV などの先端世代で需要拡大が見込まれる PAG モノマー（ポリマーバウンド型）の開発・評価を加速しており、本投資により、将来需要を見据えた供給体制の強化を 2 年前倒しで実行します。

A D E K A は今後も、先端フォトレジスト向け光酸発生剤と MOR 用金属化合物を両輪に、先端リソグラフィ技術の進化を素材でリードし、半導体材料事業のさらなる拡大を図ってまいります。

■ 概 要

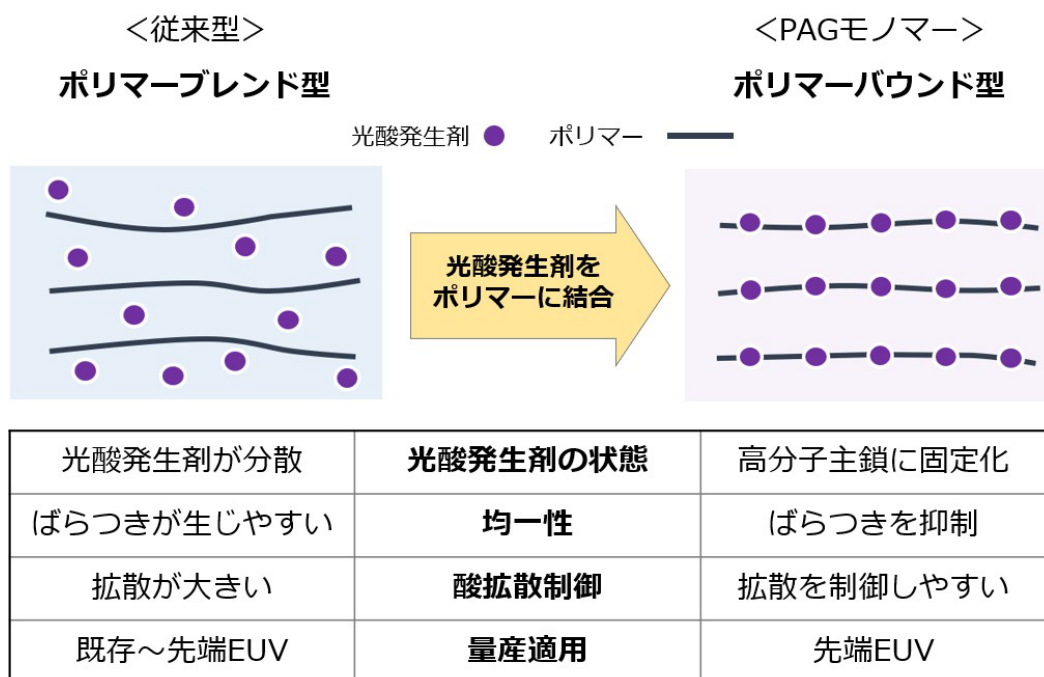
投 資 内 容	先端フォトレジスト向け光酸発生剤 製造設備の増強（ライン増設）
所 在 地	(株) A D E K A 千葉工場 （千葉県袖ヶ浦市北袖 3 - 1）
投 資 金 額	約 10 億円
能 力 増 強	従来比 約 2 倍
スケジュール （ 予 定 ）	着工：2027 年 1 月 完工：2028 年 2 月 営業運転開始：2028 年 9 月



▲ 千葉工場の光酸発生剤プラント

補足１：化学増幅型レジスト用光酸発生剤について

化学増幅型レジスト（CAR）に用いられる光酸発生剤（PAG）は、露光により発生した酸が化学反応を促し、半導体ウエハ上に微細な回路パターンを描くことができます。半導体の高性能化や微細化の進展に伴い、ArF や EUV 露光への高い感度と、高精度・高解像度を実現する性能が求められています。こうしたニーズに応えるべく、ADEKA は、従来型の光酸発生剤（ポリマーブレンド型）に加え、PAG モノマーの開発、拡販を進めています。PAG モノマーにより、光酸発生剤を高分子主鎖に固定化することで酸の拡散をコントロールし、より微細で高精度な回路形成を実現します。



補足２：金属酸化物レジスト（MOR）用金属化合物について

MOR 用金属化合物は、半導体の高集積化や高積層化に伴い、高 NA EUV 露光の導入が進むなか需要拡大が見込まれる材料です。フォトレジストの EUV 吸収率やエッチング耐性を向上させるキーマテリアルとして期待されています。ADEKA は、ALD 材料で培った金属錯体技術を応用し、次世代 MOR 用金属化合物の開発と供給体制の強化を進めています。2028 年 4 月には、鹿島化学品工場（茨城県神栖市）において専用プラントの営業運転を開始する予定です。

以 上

- 本リリースについてのお問い合わせ先
株式会社 ADEKA 法務・広報部 総務・広報グループ
Tel:03-4455-2803／E-mail: somu@adeka.co.jp